

先端ICTデバイスラボ

～ 持続可能な社会を支える100万分の1ミリの加工技術～



概要

先端ICTデバイスラボは、持続可能な社会基盤の構築をめざし、産学官連携によるデバイス研究を推進するオープンイノベーション拠点です。100万分の1ミリの加工技術を活用することで、最先端デバイスの基盤技術を創造しています。

電子線描画装置
レーザ描画装置
紫外線露光装置



ドライエッチング
ウエットエッチング
ポリッシング装置



えがく
リソグラフィ技術

けずる
エッチング技術

デバイス
研究開発

はかる
計測技術

つける
成膜技術

光・THz波計測装置
プロセス評価装置
高周波計測装置



電子ビーム蒸着装置
プラズマ化学気相堆積
スパッタリング装置



特徴

- ・ 特色ある4拠点でデバイス研究開発
 1. 光デバイス施設(本部)、2. 高周波電子デバイス施設(本部)
 3. フロンティアデバイス関連施設(神戸)、4. デバイス協創施設(神戸)
- ・ 光・超高周波デバイス・超電導デバイス等の開発
- ・ 開発デバイスの高精度評価が可能な環境を準備
- ・ 環境に配慮した研究開発環境の提供
 - * 環境ISO14001認定取得(本部)

外部利用制度の利用形態

- ・ NICT研究者との共同研究型
- ・ NICT委託研究推進型
- ・ 開発成果を提供いただく研究連携型
- ・ 自由度の高い成果活用・施設等供用型

今後の展開

- ・ デバイス加工工程の高精度化
- ・ 標準デバイス作製メニューの提供
- ・ 計測、評価手法の提供